

Title (en)  
Contactless notching

Title (de)  
Kontaktlose Rastung

Title (fr)  
Crantage sans contact

Publication  
**EP 2998799 A1 20160323 (FR)**

Application  
**EP 14185439 A 20140918**

Priority  
EP 14185439 A 20140918

Abstract (en)  
[origin: WO2016041772A1] The invention relates to a clock-making mechanism (100) comprising a first component (300) that is movable relative to a second component (200), comprising means for applying a resistant force of variable strength between a first surface (30) of the first component (300) and a second surface (20) of the second component (300), the first surface (30) comprising first magnetic areas, the second surface (20) comprising second magnetic areas, the first surface (30) and/or the second surface (20) generating magnetic fields having variable strength along the interface between the first surface (30) and the second surface (20) over the entire course of relative movement between the first component (300) and the second component (200), said fields attracting or repelling the second surface (20) and/or the first surface (30) and generating a resistant force when a force is applied to the first component (300) relative to the second component (200). One particular use consists in a barrel drum that does not have a slipping mainspring.

Abstract (fr)  
Mécanisme d'horlogerie (100), comportant un premier composant (300), mobile par rapport à un deuxième composant (200), comportant des moyens d'application d'un effort résistant d'intensité variable entre une première surface (30) dudit premier composant (300) et une deuxième surface (20) dudit deuxième composant (300). Ladite première surface (30) comporte des premières zones magnétiques, ladite deuxième surface (20) comporte des deuxièmes zones magnétiques, ladite première surface (30) ou/et ladite deuxième surface (20) génère des champs magnétiques, d'intensité variable le long de l'interface entre ladite première surface (30) et ladite deuxième surface (20) sur l'ensemble de la course de mobilité dudit premier composant (300) par rapport audit deuxième composant (200), lesdits champs agissant pour attirer ou repousser ladite deuxième surface (20) ou/et ladite première surface (30), et générer un effort résistant lors de l'application d'un effort audit premier composant (300) par rapport audit deuxième composant (200).

IPC 8 full level  
**G04B 1/20** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**G04B 1/20** (2013.01); **G04B 19/283** (2013.01)

Citation (search report)

- [X] EP 1959319 A1 20080820 - JIMENEZ PITA ANICETO [ES]
- [X] WO 2011051498 A1 20110505 - LVMH SWISS MFT SA [CH], et al
- [X] EP 1930794 A1 20080611 - SWATCH GROUP RES & DEV LTD [CH]
- [X] WO 0244818 A1 20020606 - TAG HEUER SA [CH], et al
- [X] WO 2006045824 A2 20060504 - TAG HEUER SA [CH], et al
- [X] CH 583430 B5 19761231 - SUISSE HORLOGERIE
- [A] GB 751461 A 19560627 - REINHARD STRAUMANN
- [A] US 137437 A 18730401
- [A] WO 2011069273 A1 20110616 - ROLEX SA [CH], et al
- [A] EP 2390732 A1 20111130 - ASS SUISSE POUR LA RECH HORLOGERE [CH]

Cited by  
EP4020100A1; CN114675520A; EP3373080A1; US10488823B2; WO2023083502A1; EP3163381A1

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 2998799 A1 20160323**; WO 2016041772 A1 20160324

DOCDB simple family (application)  
**EP 14185439 A 20140918**; EP 2015070003 W 20150902